文章编号:1004-0609(2009)11-2044-06

氨络合物体系中杂质 Zn²⁺对电沉积镍的影响

曹华珍,秦爱玲,郑国渠,杜征峥

(浙江工业大学 化学工程与材料学院,杭州 310032)

摘 要:通过霍尔槽试验研究氨络合物体系中杂质 Zn^{2+} 对镍电沉积的影响,采用电化学工作站测试不同 Zn^{2+} 浓度 时的循环伏安曲线、稳态极化曲线及电流时间暂态曲线。结果表明 杂质 Zn^{2+} 的含量为 0.1 g/L 时,在小于 2.78 A/dm 的电流密度范围内可正常沉积出金属镍;杂质 Zn^{2+} 含量大于 0.5 g/L 时,在较大的电流密度范围内均无法正常沉 积出金属镍;过电位小于 640 mV 时, Zn^{2+} 的存在不影响阴极反应的传递系数,且不改变阴极反应机理;当过电 位大于 640 mV,且杂质 Zn^{2+} 的浓度大于 0.5 g/L 时,阴极反应的传递系数减小,阴极反应机理发生改变;杂质 Zn^{2+} 浓度大于 0.5 g/L 时,严重影响镍电结晶过程的成核速率,这是其抑制金属镍电沉积的主要原因。因此,采用镍 氨络合物体系电积金属镍,应控制杂质 Zn^{2+} 的含量小于 0.1 g/L。 关键词:镍;锌;氨络合物;阴极过程;电结晶

中图分类号:TQ 53 文献标识码:A

Effect of impurity Zn²⁺ on nickel electrodeposition in solution containing ammonia complex

CAO Hua-zhen, QIN Ai-ling, ZHENG Guo-qu, DU Zheng-zheng

(College of Chemical Engineering and Materials Science, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310032, China)

Abstract: In nickel ammonia system, the influence of impurity Zn^{2+} on the nickel electrodeposition was studied intensively by Hull Cell experiments, and the cyclic voltammetry, cathodic polarization and chronoamperometric curves were tested at different Zn^{2+} concentration by electrochemistry working station. The results show that nickel can be deposited normally when the concentration of impurity Zn^{2+} is 0.1 g/L and the cathodic current density is less than 2.78 A/dm. When the concentration of impurity Zn^{2+} is greater than 0.5 g/L, nickel can't be deposited normally in a wide range of current density. The cathodic transfer coefficient α and reaction mechanism will not change with the addition of impurity Zn^{2+} when the overpotential is less than 640 mV. The cathodic transfer coefficient α decreases and the reaction mechanism changes when the overpotential is greater than 640 mV and the concentration of impurity Zn^{2+} is greater than 0.5 g/L. The nucleation rate during nickel electrocrystallization is restrained greatly when the impurity Zn^{2+} concentration is greater than 0.5 g/L, which is the main reason that inhibits the nickel electrodeposition. So, during electrowinning nickel from ammonia system, the content of purity Zn^{2+} should be controlled less than 0.1 g/L.

Key words: nickel; zinc; ammonia complex; cathodic process; electrocrystallization

氨络合物体系提取金属镍主要包括氨浸过程和电 积镍两个过程。氨浸过程能够选择性地浸出金属镍, 而与铁钙铝硅等常见杂质几乎不发生作用,浸出液纯 净,产品纯度高,浸出剂可循环使用。氧化镍矿的还 原熔烧、氨浸工艺(尼加罗法^[1])早已投入工业生产。利 用氨浸法处理各种含镍金属的物料及低品位复杂矿的 研究也常见报道^[2-4]。

氨络合物体系电积金属镍^[5-7]无需加入硼酸缓冲

收稿日期:2008-11-19;修订日期:2009-05-12

基金项目:国家自然科学基金资助项目(50004005);浙江省重大科技专项基金资助项目(2006C13068)

通信作者:郑国渠,教授,博士;电话:0571-88320429;E-mail:Zhenggq@zjut.edu.cn

剂,可利用体系本身的 NH₃-NH₄Cl 缓冲液,单位体积 电解液中镍沉积量大,每吨镍生产溶液的循环量少, 生产成本减少,且电流效率较高,电解液体系内溶液 电阻小,槽压低,能量利用率高,比传统镍电解节约 30%的电能。采用钌钛阳极,电积过程中阳极反应产 生氮气^[8],几乎不放出腐蚀性极强的 Cl₂,有利于环境 保护,因此,氨络合物体系中电积金属镍已成为湿法 提取金属镍的一个重要研究方向。

在氨浸过程中能进入浸出液的杂质金属离子主要 有铜、钴和锌等离子。杂质铜离子、钴离子易用置换 法、硫化沉淀法或萃取法去除^[9-10],而去除杂质锌离 子难度较大,且有关杂质锌离子对氨络合物体系电积 金属镍的影响未见文献报道。

在长期研究氨体系电积金属的基础上^[11-13],本文 作者主要研究杂质 Zn²⁺对氨络合物体系中镍阴极电沉 积过程的影响,为氨络合物体系电积金属镍在工业上 的应用提供理论指导。

1 实验

1.1 电解液组成

试验研究采用的基础液组成为 1 mol/L NiCl₂, 1 mol/L NH₄Cl, 3 mol/L NH₃·H₂O,添加的杂质 Zn²⁺浓 度范围为 0~1.0 g/L,系用二次蒸馏水配制,试验所用 试剂均为分析纯。配制的电解液存于密闭容器中静置 1 d 后使用。





采用 250 mL 霍尔槽, 阴极铜板尺寸 100 mm × 70 mm, 电流强度 1 A, 以不溶性钌钛阳极作为对电极, 试验时间 10 min。

1.3 电化学测试

采用 CHI650 电化学工作站测试循环伏安曲线及 极化曲线,测试装置采用传统的三电极电解槽,工作 电极为镶嵌在环氧树脂内的不锈钢电极,裸露面积 1 cm²,辅助电极为铂电极,参比电极为饱和甘汞电极。 试验中,研究电极与参比电极间采用带有鲁金毛细管 的盐桥连接,以减少溶液的电压降对测量的影响。工 作电极在使用前均采用金相砂纸逐级打磨,并用无水 乙醇除油。

电流—时间暂态曲线的测试装置同上,工作电极 采用玻碳电极,其工作面积为 0.125 6 cm²,每次测定 之前,工作电极均在氧化铝抛光介质作用下于金丝绒 布上抛光至镜面,并采用无水乙醇除油。

2 结果与讨论

2.1 杂质 Zn²⁺及电流密度对镍电沉积的影响

图 1 所示为霍尔槽试验阴极铜板上的沉积情况。 在氨络合物体系中沉积金属镍的表面呈黑色,黑色表 面层下即为具有金属光泽的镍,因此,黑色区域表示 镍正常沉积的区域,沉积层较厚。灰色区域也是镍正





Fig.1 Hull Cell results in solutions containing nickel ammonia complex with different Zn^{2+} contents at 25 ($c(NiCl_2 \cdot 6H_2O) = 1 mol/L$, $c(NH_4Cl) = 1 mol/L$, $c(NH_3 \cdot H_2O) = 3 mol/L$, scanning rate of 10 mV/s): (a) 0 g/L; (b) 0.1 g/L; (c) 0.5 g/L; (d) 1.0 g/L

常沉积的区域,但沉积层很薄,有露底现象。银白色 区域的沉积层组成为镍锌合金。

表 1 所列为在 Zn²⁺含量不同时镍氨电解液中以 4 A/dm² 的电流密度电沉积 2 h 后获得的阴极沉积层的 组成。从表 1 中可以看出,在试验条件下沉积层中锌 镍的质量比远远超出了电解液中锌镍的质量比,属于 异常共沉积。

表1 杂质 Zn²⁺对阴极沉积层的组成的影响

Table 1 Influence of impurity Zn^{2+} on deposits composition in cathode

$\begin{array}{c} \text{Concentration} \\ \text{of } Zn^{2^+} \text{ in} \\ \text{electrolyte/} \\ (g \cdot L^{-1}) \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{Concentration} \\ \text{of Ni}^{2^+} \text{ in} \\ \text{electrolyte/} \\ (g \cdot L^{-1}) \end{array}$	<i>m</i> (Zn)/ <i>m</i> (Ni) in solution	<i>m</i> (Zn)/ <i>m</i> (Ni) in deposit
0.1	58.69	0.001 7	0.038
0.5	58.69	0.008 5	0.230
1.0	58.69	0.017 0	1.350

从图 1 可以看出,在镍氨电解液中,当杂质 Zn²⁺ 的含量为 0.1 g/L 时,在小于 2.78 A/dm 的电流密度范 围内,均可正常沉积出金属镍;在较大的电流密度下 将会发生锌镍合金的异常共沉积现象。随杂质 Zn²⁺含 量的增加,正常沉积的电流密度范围迅速缩小,从图 1(c)和(d)中可看出,当 Zn²⁺含量为 0.5 g/L 和 1.0 g/L 时,正常沉积的电流密度范围很小,且在此范围内沉 积速率很低,沉积层薄且有露底现象,说明此时杂质 Zn²⁺的存在明显抑制了金属镍的正常沉积。

2.2 循环伏安曲线

图 2 所示为不锈钢电极在含有不同浓度锌离子的 镍氨络合物电解液中的循环伏安曲线。从图 2 可以看 出,在不含 Zn²⁺的电解液和含 0.1 g/L Zn²⁺的电解液中, 两者的循环伏安曲线在-0.71 V 左右均出现一还原峰, 在-0.35 V 左右出现一氧化峰,而 Zn²⁺浓度大于 0.5 g/L 的电解液中,还原峰和氧化峰均消失。图 3 所示为不 锈钢在只含有锌的氨络合物电解液中的循环伏安曲 线。从图 3 中可以看出,在测试的电位范围内未出现 明显的氧化峰和还原峰,即没有发生锌的沉积。结合 图 2 可看出,在-0.71 和-0.35 V 出现的还原/氧化峰对 应于 Ni²⁺/Ni 氧化还原反应。镍氨电解液中加入 0.1 g/L Zn²⁺,未出现新的电流峰,说明该浓度下的杂质 Zn²⁺ 对镍的电沉积影响不大;当杂质 Zn²⁺含量大于 0.5 g/L 时,镍氧化还原峰消失,此时杂质锌对金属镍的电沉 积起到强烈的抑制作用。



图 2 25 时 Zn²⁺含量不同的镍氨电解液中的循环伏安曲线 **Fig.2** Cyclic voltammetry curves in solutions containing nickel ammonia complex with different Zn²⁺ contents at 25 $(c(\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})=1 \text{ mol/L}, c(\text{NH}_4\text{Cl})=1 \text{ mol/L}, c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})=3 \text{ mol/L}, \text{ scanning rate of } 10 \text{ mV/s})$





Fig.3 Cyclic voltammetry curves in solution containing zinc ammonia complex at 25 $(\rho(Zn^{2+})=10 \text{ g/L}, \rho(NH_4Cl)=1 \text{ mol/L}, \rho(NH_3\cdot H_2O)=3 \text{ mol/L}, \text{ scanning rate of } 10 \text{ mV/s})$

2.3 反应动力学参数

图 4 所示为不锈钢电极在含不同 Zn²⁺浓度的镍氨 电解液中的稳态极化曲线。将 η —J 曲线转换为 η —lgJ 曲线得到图 5。由图 5 可看出,过电位在 100~640 mV 范围内,镍沉积反应的电流密度和过电势服从 Tafel 关系, η =2.55+0.626lgJ,根据直线的斜率可计算出表 观传递系数 α 为 0.05,交换电流密度 J^0 为 8.5 × 10⁻⁵ A/cm²;当过电位大于 640 mV 时,曲线斜率发生了明 显变化,此时表观传递系数 α 为 0.2。

表 2 所列为 25 时在 Zn²⁺含量不同的镍氨电解 液中阴极反应的传递系数和交换电流密度。从表 2 可 以看出,氨络合物体系中镍还原反应的交换电流密度



图 4 Zn²⁺含量不同的镍氨电解液中的极化曲线

Fig.4 Cathodic polarization curves in solutions containing nickel ammonia complex with different Zn^{2+} contents (scanning rate 0.5 mV/s)





Fig.5 η —lg*J* curve in solution containing nickel ammonia without Zn^{2+}

表 2 25 时不同 Zn^{2+} 含量的电解液中镍阴极反应的传递 系数 α 和交换电流密度 J^0

Table 2 Cathodic transfer coefficient α and exchange current J^0 in solutions with different Zn^{2+} contents at 25

Zn^{2+} content/	α		$J^{0}\!/$
$(g \cdot L^{-1})$	$\eta < 640 \ {\rm mV}$	$\eta > 640 \text{ mV}$	$(A \cdot cm^{-2})$
0	0.05	0.20	8.5×10^{-5}
0.1	0.05	0.19	8.0×10^{-5}
0.5	0.05	0.13	7.4×10^{-5}
1.0	0.06	0.08	8.3×10^{-5}

较小,在过电位小于 640 mV 的情况下,杂质 Zn²⁺的 加入对镍还原反应的传递系数和交换电流密度的影响

不大,即不改变镍阴极反应的机理,阴极过程是镍的 正常沉积;当过电位大于 640 mV 时,0.1 g/L 杂质锌 的加入对表观传递系数影响很小;而当杂质 Zn²⁺的浓 度大于 0.5 g/L 时,表观传递系数明显减小,阴极反应 机理发生变化。这可能是由于在镍氨络合物体系中, 溶液的 pH 值呈弱碱性,在较大的过电位下由于析氢 引起阴极表面的 pH 值进一步升高,在阴极表面形成 Zn(OH)₂ 吸附层,镍氨络离子必需穿过吸附层才能放 电,金属镍的沉积受到抑制,从而导致了异常共沉 积^[14-15]。

图 6 所示为在氯化铵浓度不同的电解液中测得的 循环伏安曲线。根据巨少华等^[16]的研究结果可知,随 氯化铵浓度的升高,溶液中的 Zn(OH)₂物种浓度呈递 减趋势。从图 6 可以看出,随氯化铵浓度的升高,镍 的氧化还原峰电流升高,杂质锌对金属镍电沉积的阻 滞作用减小,由此进一步证实了形成 Zn(OH)₂吸附层 是影响镍阴极电沉积的主要原因。



图 6 25 时氯化铵浓度对循环伏安曲线的影响

Fig.6 Effect of NH₄Cl concentration on cyclic voltammetry curves in solutions at 25 ($\rho(Zn^{2+})=0.5 \text{ g/L}, c(NiCl_2 \cdot 6H_2O)=1 \text{ mol/L}, c(NH_3 \cdot H_2O)=3 \text{ mol/L}, \text{ scanning rate } 10 \text{ mV/s})$

2.4 晶核的形成

图 7 所示为在含杂质锌的镍氨电解液中测得的电 流—时间暂态曲线。从图 7 中可看出,电结晶经历成 核过程,电结晶的初期由于晶核的形成和新相的生成, 电流迅速上升,在电流达到最大值后出现电流衰减, 此时镍电结晶过程经历了生长中心的交叠并向外生长 伸向溶液,同时伴随生长中心的消失和新生长中心的 再生。从图 7 中还可以看到,在-1.05 V 的阶跃电位下, 随杂质 Zn²⁺含量的增加,达到峰电流的时间延长,峰 电流减小;当杂质 Zn²⁺含量增大至 1 g/L 时,出现反 常现象,峰电流反而增大,这可能此时发生了锌镍合



图7 不同 Zn²⁺含量的镍氨电解液中的电流—时间暂态曲线 Fig.7 Current transient curves in solutions containing nickel ammonia complex with different Zn²⁺ contents at potential of -1.05 V)

金异常共沉积所引起的。

SHARIFKER 和 HILLS^[17]曾导出液相传质控制时 半球晶核三维生长的电流表达式为

对于瞬时成核

$$I = \frac{zFD^{1/2}C}{\pi^{1/2}t^{1/2}} [1 - \exp(-N_0\pi kDt)]$$
(1)

对于连续成核

$$I = \frac{zFD^{1/2}C}{\pi^{1/2}t^{1/2}} [1 - \exp(-A\pi k'Dt^2/2)]$$
(2)

式中: zF 为沉积离子的摩尔电荷; D 为沉积离子的扩 散系数; C 为沉积离子的浓度; M 为沉积相的摩尔质 量; N₀为晶核密度; A 为成核速度常数。

式(1)和(2)表示的暂态电流存在极值,通过求导可 分别得到 t_m 、 I_m 和 I^2/I^2_m 的表达式,其结果列入表 3。

图 8 所示为在不同 Zn²⁺含量的镍氨电解液中的无 因次曲线以及由表 3 导出的瞬时成核和连续成核的无 因次曲线。瞬时成核与连续成核仅是成核速度常数很 大和很小时出现的两种极端情况,瞬时成核的峰较宽,

表 3 由(1)和(2)导出的关系式

而连续成核的峰相对尖锐。由图 8 可看出,不含杂质 锌及杂质锌含量为 0.1 g/L 时,其成核的无因次曲线接 近连续成核,即成核速率较小;杂质锌含量为0.5g/L 和 1.0 g/L 时,无因次曲线的峰变得更加尖锐,说明此 时成核非常困难,即杂质锌含量大于0.5g/L时,会大 大降低阴极过程的成核速率,从而抑制了金属镍的沉 积,这与循环伏安曲线测试的结果一致。



图 8 不同 Zn²⁺含量的镍氨电解液中的无因次曲线 Fig.8 Non-dimensional plots in solutions containing nickel ammonia complex with different Zn²⁺ contents

结论 3

1) 镍氨电解液中,杂质 Zn²⁺的含量为 0.1 g/L 时, 在小于 2.78 A/dm²的电流密度范围内,均可正常沉积 出金属镍;杂质 Zn²⁺含量大于 0.5 g/L 时,在较大的电 流密度范围内均无法正常沉积出金属镍。

2) 镍氨络合物电解液中,当过电位小于 640 mV 时,Zn²⁺的存在不影响阴极反应的传递系数和交换电 流密度,不改变阴极反应机理;当过电位大于640mV 时,在杂质 Zn²⁺的浓度大于 0.5 g/L 的电解液中,阴极 反应的表观传递系数明显减小,阴极反应机理发生了 改变。

Table 3 Expressions derived from Eqs.(1) and (2)				
Parameter	Instantaneous nucleation	Continuous nucleation		
t _m	$1.256 \ 4/(N_0 \pi kD)$	$[4.673 \ 3/(A\pi k'D)]^{1/2}$		
I _m	$0.638 \ 2zFDC(kN_0)^{1/2}$	$0.461 \ 5zFD^{3/4}C(k'A)^{1/4}$		
$I^2/{I_{\rm m}}^2$	$\frac{1.9542}{t/t_{\rm m}} \times \{1 - \exp[-1.2564(t/t_{\rm m})]\}^2$	$\frac{1.2254}{t/t_{\rm m}} \times \{1 - \exp[-2.3367(t/t_{\rm m})^2]\}^2$		

3) 当杂质 Zn²⁺的浓度大于 0.5 g/L ,严重影响镍电结晶过程的成核速率,这是其抑制金属镍电沉积的主要原因。因此,采用氨络合物体系电积金属镍时应控制电解液中杂质 Zn²⁺含量低于 0.1 g/L。

REFERENCES

- De GRAAF J E. The treatment of lateritic nickel ores—A further study of the carbon process and other possible improvements. Part I. Effect of reduction conditions[J]. Hydrometallurgy, 1979, 5(1): 47–65.
- [2] GRUJICIC D, PESIC B. Electrochemical and AFM study of nickel nucleation mechanisms on vitreous carbon from ammonium sulfate solutions[J]. Electrochimica Acta, 2006, 51(13): 2678–2690.
- [3] 尹 飞,阮书锋,江培海,王成彦,陈永强.低品位红土镍矿 还原培砂氨浸试验研究[J]. 矿冶,2007,16(3):29-32.
 YIN Fei, RUAN Shu-feng, JIANG Pei-hai, WANG Cheng-yan, CHEN Yong-qiang. Experimental study on roasted ore of poor nickelferous laterite ore with ammonia leaching technology[J].
 Mining and Metallurgy, 2007, 16(3): 29-32.
- [4] 王浩东,曾佑生.用氨浸从电镀污泥中回收镍的工艺研究[J]. 化工技术与开发,2004,33(1):36-38.
 WANG Hao-dong, ZENG You-sheng. Nickel recovering technology from electroplating sludge in the way of ammonia-leaching[J]. Technology & Development of Chemical Industry, 2004, 33(1): 36-38.
- [5] 薛文颖, 申勇峰, 赵宪明. 氯气浸出-电积工艺从铜渣中提取 镍[J]. 有色金属, 2008, 60(1): 77-79.
 XUE Wen-ying, SHEN Yong-feng, ZHAO Xian-ming. Ni extraction from Cu residue by chlorine leaching-electrowinning process[J]. Nonferrous Metals, 2008, 60(1): 77-79.
- [6] 郑国渠,郑利峰,张 昭,曹华珍,张九渊. 氨络合物体系电 积镍的机理研究[J]. 有色金属,2004,56(3):45-48. ZHENG Guo-qu, ZHENG Li-feng, ZHANG Zhao, CAO Hua-zhen, ZHANG Jiu-yuan. Nickel electrodeposition mechanism from leaching solution containing ammonia and chloride[J]. Nonferrous Metals, 2004, 56(3): 45-48.
- [7] ZHENG Guo-qu, ZHENG Li-feng, CAO Hua-zhen, GAO Zhi-feng, NI Si-yu, ZHANG Jiu-yuan. Nickel electrodeposition from leaching solution containing ammonia and chloride[J]. Trans Nonferrous Met Soc China, 2003, 13(1): 217–220.
- [8] 郑国渠,高志峰,曹华珍,郑利峰,倪似愚,张九渊. 氨络合物体系电积金属镍的阳极过程[J]. 有色金属, 2003, 55(2): 31-32, 57.

ZHENG Guo-qu, GAO Zhi-feng, CAO Hua-zhen, ZHENG Li-feng, NI Si-yu, ZHANG Jiu-yuan. Anodic process of nickel electrowinning from leaching solution containing ammonia and chloride[J]. Nonferrous Metals, 2003, 55(2): 31–32, 57.

[9] 刘三平, 王海北, 蒋开喜, 王玉芳. 钴提取分离技术分析与应

用[J]. 有色金属, 2004, 56(2): 73-76.

LIU San-ping, WANG Hai-bei, JIANG Kai-xi, WANG Yu-fang. Cobalt separation technologies and their application to scrap treatment[J]. Nonferrous Metals, 2004, 56(2): 73–76.

 [10] 梁 妹. 从废弃炉渣中分离回收钴、镍[J]. 湿法冶金, 2007, 26(3): 157-161.

LIANG Mei. Separation and recovery of cobalt and nickel from waste slag[J]. Hydrometallurgy of China, 2007, 26(3): 157–161.

[11] 郑国渠,郑利峰,曹华珍,张九渊. 氨络合物体系中Ti基IrO₂
 涂层阳极的析氮过程[J].中国有色金属学报,2005,15(1):
 84-88.

ZHENG Guo-qu, ZHENG Li-feng, CAO Hua-zhen, ZHANG Jiu-yuan. Nitrogen evolution of Ti based IrO₂ anodes in leaching solution containing ammonia and chloride[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2005, 15(1): 84–88.

[12] 郑利峰,郑国渠,曹华珍,张九渊. 氨络合物体系中镍在玻璃 碳上的电化学成核机理[J]. 材料科学与工程学报,2003,21(6): 882-885.

ZHENG Li-feng, ZHENG Guo-qu, CAO Hua-zhen, ZHANG Jiu-yuan. Electrochemical nucleation of nickel on vitreous carbon in leaching solution containing ammonia and chloride[J]. Journal of Materials Science & Engineering, 2003, 21(6): 882-885.

- [13] 曹华珍,郑国渠,支 波. 氨络合物体系电积锌的阴极过程
 [J]. 中国有色金属学报, 2005, 15(4): 655-660.
 CAO Hua-zhen, ZHENG Guo-qu, ZHI Bo. Cathodic process of zinc electrowinning insolution containing ammonia complex[J].
 The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2005, 15(4): 655-660.
- [14] 何 为. 锌镍合金的异常共沉积与正常共沉积的转变[J]. 表面技术, 1998, 27(2): 22-25.
 HE Wei. The transition of Zn-Ni alloys from anomalous codeposition to normal codeposition in electrodeposition[J]. Surface Technology, 1998, 27(2): 22-25.
- [15] 吴继勋,刘永勤,卢燕平,孟惠民. 锌-镍合金共沉积的交流 阻抗行为[J]. 材料保护, 1994, 27(1): 16-19.
 WU Ji-xun, LIU Yong-qin, LU Yan-ping, MENG Hui-min. A C impedance characteristics of Zn-Ni alloy codeposition[J]. Materials Protection, 1994, 27(1): 16-19.
- [16] 巨少华,唐谟堂,杨声海.用 MATLAB 编程求解
 Zn()-NH₄Cl-NH₃-H₂O 体系热力学模型[J].中南大学学报:
 自然科学版, 2005, 36(5): 821-827.

JU Shao-hua, TANG Mo-tang, YANG Sheng-hai. Thermodynamic model of Zn()-NH₄Cl-NH₃·H₂O system using MATLAB programming[J]. Journal of Central South University of Technology: Natural Science, 2005, 36(5): 821–827.

[17] SCHARIFKER B, HILLS G. Theoretical and experimental studies of multiple nucleation[J]. Acta Electrochimica, 1983, 28(7): 879–889.

(编辑 李艳红)